

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 2 月 19 日 (19.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/014987 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08G 85/00, 61/12, C08J 5/00, A61F
2/08, 2/70, B32B 27/00 // C08L 101:00

特願 2002-307559

2002 年 10 月 22 日 (22.10.2002) JP

特願 2002-307472

2002 年 10 月 22 日 (22.10.2002) JP

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/010111

(22) 国際出願日: 2003 年 8 月 8 日 (08.08.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イーメックス株式会社 (EAMEX CORPORATION) [JP/JP]; 〒563-0042 大阪府 池田市宇保町 5 番 1 6-6 0 8 号 Osaka (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 座間 哲司 (ZAMA, Tetsuji) [JP/JP]; 〒563-0042 大阪府 池田市宇保町 5 番 1 6-6 0 8 号 イーメックス株式会社内 Osaka (JP). 原 進 (HARA, Susumu) [JP/JP]; 〒563-0042 大阪府 池田市宇保町 5 番 1 6-6 0 8 号 イーメックス株式会社内

(30) 優先権データ:

特願 2002-233617 2002 年 8 月 9 日 (09.08.2002) JP

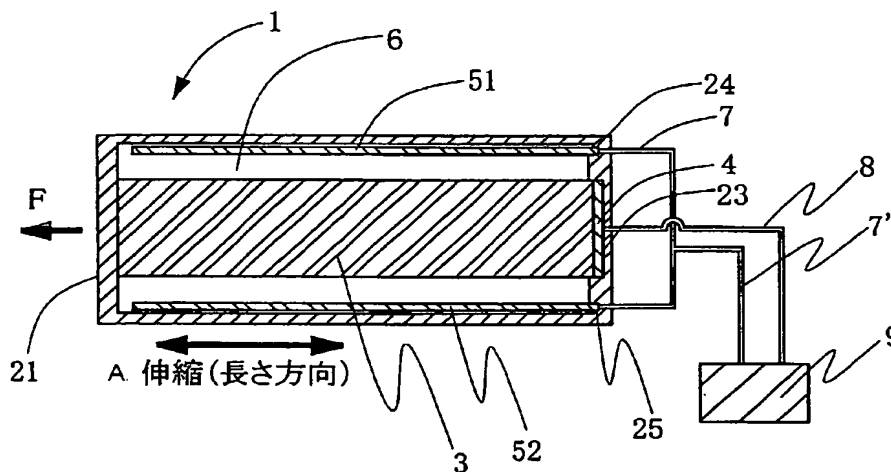
特願 2002-265859 2002 年 9 月 11 日 (11.09.2002) JP

特願 2002-289365 2002 年 10 月 2 日 (02.10.2002) JP

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING CONDUCTIVE POLYMER

(54) 発明の名称: 導電性高分子の製造方法



A...EXPANSION/CONTRACTION (LENGTHWISE DIRECTION)

(57) Abstract: A process for producing a conductive polymer excellent in the degree of expansion/contraction per oxidation/reduction cycle. The process is for producing by the electrolytic polymerization method a conductive polymer having the property of expanding/contracting upon electrochemical oxidation/reduction. The electrolytic polymerization method is a polymerization method in which an electrolytic solution containing an organic compound as a solvent is used. The organic compound contains in the molecule (1) at least one kind of chemical bond selected from the group of an ether bond, ester bond, carbon-halogen bond, and carbonate bond and/or (2) at least one functional group selected from the group consisting of hydroxy, nitro, sulfo, and nitrile groups. The electrolytic solution contains trifluoromethanesulfonate ions and/or anions comprising a central atom and two or more fluorine atoms bonded thereto.

(57) 要約: 優れた 1 酸化還元サイクル当たりの伸縮率の導電性高分子の製造方法を提供する。 電解重合法による導電性高分子の製造方法であって、前記導電性高分子

[続葉有]

WO 2004/014987 A1